

真空ステーションCvd装置付きスプリットチャンバーCvd管状炉

商品番号: KT-CTF12



前書き

真空ステーション付きスプリットチャンバーCVD管状炉 -

先端材料研究用の高精度1200°C実験炉。カスタマイズ可能なソリューション

[詳細を学ぶ](#)

炉モデル	KT-CTF12-60
最高温度	1200°C
一定作業温度	1100°C
炉心管材質	高純度石英
炉管の直径	60mm
加熱ゾーン長さ	1x450mm
チャンバー材質	日本アルミナ繊維
発熱体	Cr2Al2Mo2ワイヤーコイル
加熱速度	0~20°C/分
熱電対	Kタイプ
温度コントローラー	デジタル PID コントローラー/タッチ画面 PID のコントローラー
温度調整の正確さ	±1°C
スライド距離	600mm
ガス精密制御ユニット	
流量計	MFCマスフローメーター
ガスチャンネル	4チャンネル
流量	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCMCH4 mfc3: 0-100sccm h2 mfc4: 0-500sccm n2
直線性	±0.5% F.S.
繰り返し性	±0.2% F.S.
パイプラインとバルブ	ステンレス鋼
最高使用圧力	0.45MPa

デジタルノブコントローラー/タッチスクリーンコントローラー

標準真空ユニット（オプション）

ロータリーベーン真空ポンプ

4L/S

KF25

ピラニ/抵抗シリコン真空計

10Pa

高真空ユニット (オプション)

ロータリーベーンポンプ+分子ポンプ

4L/S+110L/S

KF25

複合真空計

 $6 \times 10^{-5} \text{Pa}$

上記の仕様とセットアップはカスタマイズすることができます

いいえ	説明	数量
1	炉	1
2	石英管	1
3	真空フランジ	2
4	チューブサーマルブロック	2
5	チューブサーマルブロックフック	1
6	耐熱グローブ	1
7	精密ガスコントロール	1
8	真空ユニット	1
9	操作マニュアル	1